



ミニステッパー / Mini Step and Repeat Exposure System

NES1W-ih06 / NES1W-i06 **NES2W-ih06 / NES2W-i06**



i-h線2波長ブロードバンド対応

LED/MEMS/Power Device市場に向けた縮小投影露光装置

Newly developed i-line optics now become available on Nikon Mini Stepper NES1 and NES2 as well as current h-line optics. These new machines are our answer to highly emerging markets of LED/MEMS/Power Devices and IC back-end process.

NIKON ENGINEERING CO., LTD.



ミニステッパー Mini Step and Repeat System

NES1W-ih06 / NES1W-i06

NES2W-ih06 / NES2W-i06

i-h線2波長ブロードバンド対応。

LED/MEMS/Power Device市場に向けた縮小投影露光装置です。

Newly developed i-line optics now become available on Nikon Mini Stepper NES1 and NES2 as well as current h-line optics. These new machines are our answer to highly emerging markets of LED, MEMS, Power Devices and IC back-end process.

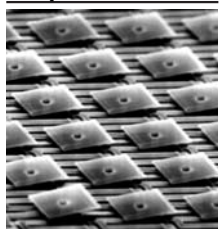
特長 Features

- i-h線2波長ブロードバンドによる高照度化：
高照度および広露光範囲による高生産性を実現
- i線レジストへの適合：i線単波長の選択が可能
- NA拡大：解像度向上
- 安全認証対応
- 深いフォーカスマージン：
厚膜レジストや高段差に対応
- 高精度な裏面アライメント機構（オプション）
- 世界最小レベルのフットプリント
- High expose power at i-line or ih-lines with 22mm×22mm area is possible that contribute to improve your productivity.
- Adaptable to i-line process as well as i-line photo resist. Solely i-line exposure is also possible
- Now projection lens of which N.A is 0.13 is the best combination of larger Depth of focus and higher resolution.
- Global safety as of SEMI 2/8 and NFPA79 is now compliant on these model as standard
- Highly accurate back side alignment both Direct and IR are now available as option.
- The smallest footprint is kept as 8" wafer handling capable machine.

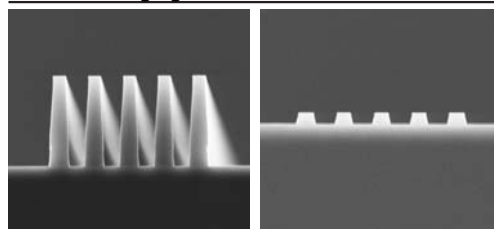
主な仕様 Specifications

		NES1W-ih06	NES1W-i06	NES2W-ih06	NES2W-i06
解像度	Resolution	2.5 μm	2.0 μm	2.5 μm	2.0 μm
投影レンズ縮小倍率	Reduction Ratio	-1/1.8		-1/1.8	
NA (開口数)	Lens-NA	0.13		0.13	
露光範囲	Exposure Area	22mm□		22mm□	
露光波長	Exp Light Source	365-405nm	365nm	365-405nm	365nm
アライメント精度	Alignment accuracy	0.3μm		0.35μm	
裏面アライメント精度 (オプション)	Backside alignment accuracy (Option)	0.8μm		0.8μm	
試料サイズ	Sample Size	φ50mm ~ φ150mm		φ150mm, φ200mm	
処理能力	Throughput	150mm: 100WPH	150mm: 95WPH	200mm: 62WPH	200mm: 59WPH
寸法/質量	Dimensions (W×D×H) / Weight	1,150 × 1,940 × 2,070mm / 1,750kg		1,440 × 2,290 × 2,100mm / 2,150kg	

Sample MEMS Device



Excellent Imaging



安全に関するご注意
Warning

■ご使用前に「使用説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

For your safety: Before using this product, please refer to the Technical Manual and follow the directions for proper use.



株式会社 ニコン エンジニアリング
http://www.ave.nikon.co.jp/n-eng/

本 社
221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-30-4
明治安田生命横浜西口ビル
TEL (045)320-1311 FAX (045)320-1395

NIKON ENGINEERING CO., LTD.
http://www.nikon.com/products/customized/index.htm

30-4, Tsuruya-cho 3-chome, Kanagawa-ku,
Yokohama-city, Kanagawa 221-0835, Japan
TEL:+81-45-320-1311 FAX:+81-45-320-1395



ISO 9001

カタログ記載の内容は2014年11月現在のものです。
このカタログの仕様および製品は製造者/販売者が何ら債務を被ることなく予告なしに変更されます。

The information in this catalog is effective as of November, 2014. Specifications and equipment are subject to change without any notice or obligation on the part of the manufacturer or seller.

事業所 239-0832 神奈川県横須賀市神明町1-15 株式会社ニコン横須賀製作所内